

【開催のお知らせ】

デジタル技術基盤分野研究会 令和8年度 先進地視察 Part 1 ～半導体製造装置 成膜技術と開発・生産の現場を巡る～

「デジタル技術基盤分野研究会」では、最新技術や市場動向に関する情報提供、および関連する新商品・新技術の開発、半導体をはじめとしたデジタル技術基盤分野への進出と技術革新を支援します。

今回の先進地視察 Part 1 は、県内に拠点を持つ企業様、株式会社 KOKUSAI ELECTRIC 富山事業所の先進的な半導体製造装置開発・製造ライン、および展示室等を視察します。また、第1回技術セミナーを現地で開催します。特長的な製造工場を視察する貴重な機会です。半導体業界、サプライチェーンの理解、自動化・効率化に是非お役立てください。

【開催概要】

■日 時：令和8年6月9日（火）

■集 合：株式会社 KOKUSAI ELECTRIC 富山事業所（現地集合、現地解散）

■視察先：

株式会社 KOKUSAI ELECTRIC 富山事業所

半導体製造装置開発・製造ライン見学、展示室見学

第1回 技術セミナー開催 ※ 別紙セミナー案内参照ください

所在地：富山県富山市八尾町保内2丁目1

■対 象：デジタル技術基盤分野研究会 会員企業、大学等の研究機関の方

■定 員：先着25名

（尚、参加企業様の業種によっては、訪問先へご入場できない可能性もありますので、あらかじめご了承ください）

■参加費：無 料

■申込締切：令和8年5月29日（金）まで

※1 但し、定員になり次第締め切ります。

※2 同じ企業から複数人申し込まれた場合、人数調整をさせて頂く場合があります。

※3 **スマートフォン、カメラ等の撮影機器は、会場・工場に持って入ることは出来ません。**

■申込方法：参加申込書に記載の上、メール又はFAXにて、事務局 水野宛にお申し込み願います。

【開催内容】

■日程表：6月9日（火）

13：20 株式会社 KOKUSAI ELECTRIC 富山事業所 集合

（第二駐車場に駐車頂き徒歩で正門からご入場ください）※ 別添案内図に従って、ご入場ください

13：30 開会・挨拶

13：40 第1回 技術セミナー

14：40 事業所見学（開発エリア、製造エリア）、展示室 見学、会社紹介ビデオ視聴

16：00 閉会

■ 内 容

KOKUSAI ELECTRIC は半導体製造装置の開発・製造・販売・保守サービスを手掛ける製造装置メーカーです。

「技術と対話で未来をつくる(Technology & Tai-wa for Tomorrow)」というコーポレートスローガンのもと、事業活動と ESG の取り組み(環境・社会課題の解決、ガバナンスの強化)の両側面から企業価値を追求するサステナビリティ経営により、SDGs の達成に寄与するとともに、持続可能な社会の実現と当社グループの持続的な発展の両立をめざしています。

半導体の製造工程において最も重要な工程の一つに、ウェーハと呼ばれる基板上に薄膜を何層も重ねる「成膜」があります。当社は、この「成膜」工程の装置を軸としてグローバルに事業を展開しており、最大 200 枚のウェーハに高品質な薄膜を一括して形成することができる「バッチ成膜装置」や、形成した膜質を改善する「トリートメント装置」は、世界の半導体メーカーから高い評価をいただいています。

なかでも「バッチ ALD 対応装置(注)」は、難易度の高い成膜と高い生産性を両立することができ、世界トップレベルのシェアを有しています。

当日は、半導体製造装置の概要、当社の技術の紹介、開発ライン、生産ラインの窓越しの見学、展示室の見学を通して、半導体製造装置業界と当社の技術についてご理解をいただければと考えております。

(注)Atomic Layer Deposition の略称。当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます。

■ 富山事業所

当社は、1949 年に日本政府の委託により、第二次世界大戦の終戦まで外地向け通信施設の建設保守業務を担当していた旧国際電気通信(株)を母体として、電気通信機器及び高周波応用機器の製造販売を目的とする国際電気(株)を設立したことから始まります。

1956 年に東京都羽村市でゲルマニウム、シリコン単結晶引き上げ装置を受注し、半導体製造装置事業を開始しました。

1989 年 5 月に北陸の優秀な人財を求め、富山市八尾町の中核工業団地内で富山事業所が操業を始めました。

以後、37 年間半導体製造装置の開発から生産まで富山県で一貫生産を行なっております。

2024 年には砺波市で製造をメインとした砺波事業所の操業を開始しました。富山事業所は引続き、研究開発および生産機能を担う中核拠点として、重要な役割を果たしています。



【第1回 技術セミナー】 ※ 別紙参照ください

題 名： 半導体デバイスのトレンドに基づく半導体製造装置に求められる開発アプローチ

講 師： 株式会社 KOKUSAI ELECTRIC

先行要素技術開発部長 佐々木 隆史 氏

【お申込み・お問い合わせ先】

(公財) 富山県新世紀産業機構 イノベーション推進センター 水野 まで

〒930-0866 富山市高田 529 TEL 076-444-5636 FAX 076-433-4207

e-mail : y.mizuno@tonio.or.jp

半導体デバイスのトレンドに基づく半導体 製造装置に求められる開発アプローチ

半導体デバイスは世代の進行とともに微細化・高集積化が進み、3次元化などによりデバイス構造は一層複雑になっています。その結果、表面積が増大し、成膜装置には高い被覆性や膜厚均一性といった厳しい要求が課せられます。

本セミナーでは、世代進行が成膜プロセスに与える影響を整理するとともに、次世代成膜装置に求められる開発アプローチについて解説します。

■ 日時：令和8年 6月9日(火)

13:40 - 14:40

■ 開催方法：
先進地視察(Part1)の現地セミナー
(注意：WEBでの配信はありません)

■ 募集人員：先着25名

■ 対象者：先進地視察参加者

講師



株式会社
KOKUSAI ELECTRIC
先行要素技術開発部長
佐々木 隆史 氏

■ 申込み方法：

別の先進地視察開催案内にてお申込ください。

- ・デジタル技術基盤分野研究会への新規入会ご希望の方は、「裏面：入会申込書」または、先進地視察申込用紙で申込みください。(FAX、Eメール、電話でも可)

講師

佐々木 隆史 氏
(ささき たかふみ)

プロフィール

2005年：株式会社日立国際電気(現KOKUSAI ELECTRIC)入社
2023年：モジュール開発部長

2026年現在：先行要素技術開発部長

北海道釧路市で生まれ育つ。大学時代は半導体製造装置内のガス流れ・熱移動の研究に従事し、可視化実験や熱評価を模擬する熱流体解析モデルを開発した。博士課程(工学)修了後、当社に入社。化学反応をともなうガス流れ解析モデルの構築を行ない装置開発をサポート。

Racing drone、車/楽曲のカスタム、アナログ的な無駄を好む三女の父。

デジタル技術基盤分野研究会入会申込書

(入会希望の方は、下記に記入ください。)

デジタル技術分野関連産業にご興味や、新たに事業参入・利活用への意欲のある企業・団体等に所属される方が対象です。

必要事項をご記入の上、e-mail 又は FAX にてお申込みください。

(セミナーの開催案内や、ロボットに関する情報提供をさせていただきます。登録人数に制限はありません。)

研究会加入申込書(加入希望者の方のお名前等をご記入ください)

※ご記入頂いた事項は、当該事業の運営の為のみに使用し、他の目的には使用しません。

企業名・団体名			
所在地	(〒)		
連絡担当者		FAX	
TEL		E-mail	
会員希望者名			
E-mail		FAX	
所属部署		職位・職名	
会員希望者名			
E-mail		FAX	
所属部署		職位・職名	

■お申込み・お問合せ先

FAX: 076-433-4207 E-mail: y.mizuno@tonio.or.jp